SiO_2 脊形条波导热极化引起的电光效应^{*}

曹 霞 秦海燕† 成丽华

(浙江大学现代光学仪器国家重点实验室 杭州 310027)(2005年11月29日收到2006年3月15日收到修改稿)

通过理论模拟对具有上覆盖层的 SiO₂ 脊形条波导结构进行了优化,在此基础上利用微电子工艺制作了 SiO₂ 脊形波导 Mach-Zehnder 型电光调制器,并进行热极化引起的电光和非线性效应的研究.热极化过程大幅增强了样品的电光及非线性效应,二次电光系数由热极化前的 1.56 × 10⁻²²(m/V)² 提高到热极化后的 8.50 × 10⁻²²(m/V)² ,极化后得到了 0.093pm/V 的线性电光系数,对热极化的物理机理进行了理论分析.

关键词:电光调制器,SiO₂光波导,电光效应,热极化 PACC:4280K,4280L,7820J,4265

1.引 言

在光纤通信集成光学器件所用到的众多光波导 材料中 *S*iO₂ 具有其独特的应用优势.SiO₂ 材料不仅 成本低 损耗小 ,宽波段透光 ,而且与硅半导体电子 工艺相匹配 ,和光纤有很好的兼容性.但是 SiO₂ 材 料通常是一种无定形体 ,具有各向同性、中心对称的 性质 ,因此它不具有线性电光效应及二阶非线性效 应 难以替代昂贵的晶体材料 ,如铌酸锂、磷酸二氢 钾(KDP)、磷酸钾钛(KTP)等.这限制了其在一些重 要光器件(如电光调制器、光开关、可调滤波器及波 长转换器等)中的应用.

1991年,Myers 等人通过在高温下对 SiO₂ 材料 进行热极化的方法^[1],成功地在 SiO₂ 中得到了二阶 非线性效应,为 SiO₂ 应用在更广阔的器件领域提供 了可能性.之后,人们通过不同的途径提高极化引起 的非线性效应,如采用不同的极化技术^[2-7]、材料组 份^[8-10]和极化控制条件^[11,12]对 SiO₂ 体材料进行研 究,而对于条波导的研究则很少.从器件应用方面, 只有日本 NTT 公司电光开关见诸报道^[13],但该器件 极化效率很低,得到的线性电光系数只有0.02pm/V.

本研究在优化 SiO₂ 脊形条波导的设计的基础 上,进行热极化处理,通过改变极化工艺过程参数以 及 SiO₂ 材料组份等方法,提高极化引起的线性电光 系数,从而设计和制作出 SiO₂ 脊形波导 Mach-Zehnder(MZ)型电光调制器,并对热极化的物理机 理进行了实验和理论研究.

2. SiO₂ 光波导热极化的机理

SiO₂的热极化过程使材料在强的外加电场(约 250 V/μm)作用下 SiO₂材料中的杂质电离子定向移 动在材料中形成内部电场或偶极子沿外电场重新取 向,当材料冷却到室温后将外加电场撤去,在高温高 电压下形成的内部电场或偶极子的重新取向不会消 退,而是冻结在材料内部,形成冻结电场 *E*_a(rec.).

热极化后的波导中的电场可以表示为以下三部 分^[14] 热极化在波导中形成的冻结电场 E_{de} (rec.) 外加调制电场 E_{de} (appl.)以及光波的电场分量 Re{ $E(\omega)$ exp(j ωt)}即

$$E = E_{dc}(\text{ rec. }) + E_{dc}(\text{ appl. })$$

+ Re{E(\omega)exp(j\omega)}, (1)

^{*}国家自然科学基金(批准号 50377022,60408001)和教育部留学回国人员科研启动基金资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail:hattieqin@coer.zju.edu.cn

(3)

因此有

 $\chi_{eff}^{(2)} = d + 6\chi^{(3)}E_{dc}(rec.),$ (4) 其中 ,**P** 为极化强度 , ϵ_0 为真空电容率 , $\chi^{(1)}$ 为电极 化率 ,**E** 为光波的电场分量 ,d 为二阶非线性光学系 数 , $\chi^{(3)}$ 为三阶非线性光学系数 , $\chi_{eff}^{(2)}$ 为等效二阶非 线性光学系数 , $E_{dc}(rec.)$ 为波导中由于极化形成的 冻结电场 , $E_{dc}(appl.)$ 为外加电场.

+ $12\gamma^{(3)}E_{d}^{2}$ (appl.) *E*,

(4) 武中,由于SiO₂材料属于无定性体,二阶非 线性光学系数 *d*为0,因此等效二阶非线性光学系 数为

$$\gamma_{\rm eff}^{(2)} = 6\gamma^{(3)}E_{\rm d}$$
 (rec.). (5)

因此 ,热极化形成材料内部冻结电场 E_{de} (rec.),引起等效二阶非线性系数 $\chi^{(2)}_{eff}$,从而在 SiO₂ 材料中会表现一定的线性电光效应及二阶非线性效应.

SiO₂ 脊形波导 MZ 型电光调制器的 设计与制作

以往的研究结果表明 "SiO₂ 电极化引起的电光 和非线性效应的有效深度为电极沿波导深度方向约 几个微米 极化电极距离导波层越近 极化的效果就 越显著 ,因此应当尽可能地使导波层接近极化电极. 另一方面 ,由于波导上方调制电极的存在需要波导 层和电极之间的缓冲层足够厚 ,以使电极引起的光 传输损耗足够低.

我们通过 BeamPROP 软件的设计和模拟,比较 具有相同覆盖层厚度的脊形波导和掩埋式波导用于 热极化实验的优劣.图 1 为两种波导结构的横截面 示意图.模拟中,取脊形条波导和掩埋式条波导的波 导参数相同(如缓冲层和导波层的折射率、厚度以及 条波导宽度等),实际模拟取 $n_1 = 1.4835$, $n_2 = 1.4687$ 基底厚度 6.5μ m,波导芯层厚度 6μ m,脊形波 导芯层非脊处厚度 4.5μ m.假设波导截面光场最大 光强为 1,计算出光衰减到波导上覆盖层表面处光 的强度,分别得到脊形波导和掩埋式波导的波导表 面光强 P 与上覆盖层厚度 d 的关系如图 2 所示(TE 偏振情形).

图 2 结果显示,上覆盖层厚度范围为 1—3µm 时,有覆盖层的脊形波导的波导表面光强比具有同 样厚度覆盖层的掩埋式波导表面光强明显要小,即 光波在脊形波导中传播能量更集中,受到电极的影 响更小,更适合用于 SiO₂ 波导的热极化研究,模拟



图 1 具有上覆盖层的脊形波导(a)和掩埋式波导(b)的横截面 结构示意图

发现,图2所示的模拟结果对波导折射率增量并不 敏感.图2为TE偏振情况下的模拟结果,模拟发现 TM偏振有相同结论.

根据以上计算结果,实验中我们取脊形波导上 覆盖层的厚度 d = 2.5μm,控制导波层相对缓冲层的 折射率增量为 1.2%,保证波导上方的调制电极不 会造成大的光传输损耗.图 3 为所设计的具有上覆 盖层的脊形波导的模拟光场分布情况.



图 2 具有上覆盖层的脊形波导与掩埋式波导的波导表面光强 P 与上覆盖层厚度 d 的关系对比



图 3 带覆盖层的脊形波导的光场分布情况

根据上述设计 ,我们利用微电子工艺制作具有

上覆盖层的 SiO₂ 脊形波导 MZ 型电光调制器.首先 在洁净的硅片上利用等离子体增强化学气相沉积方 法(PECVD)依次生长 SiO₂ 缓冲层(6.5μm 厚)和掺 GeO₂ 的 SiO₂ 导波层(6μm 厚)利用光刻工艺在基片 上形成 MZ 型电光调制器图形,用电感耦合等离子 体 ICP 对掺 GeO₂ 的 SiO₂ 导波层进行刻蚀(刻蚀深 度为 1.5μm),以形成宽 6μm 的脊形波导结构;再次 利用 PECVD 生长 SiO₂ 上覆盖层(2.5μm 厚);最后, 在 MZ 电光调制器的一个臂上依次蒸镀金属 Ti (16nm)和 N(400nm),作为极化和调制电极.



图 4 具有上覆盖层的 SiO2 脊形波导 MZ 电光调制器示意图 (a) 俯视图 ;(b) 横截面图

4. 热极化实验

在对所制作的 SiO₂ 脊形波导 MZ 型电光调制器 进行热极化处理之前,首先需要测量其电光效应,以 便与热极化处理后的电光效应性质作对比.我们较 早时期的研究¹⁵¹发现,无论极化前还是极化后,SiO₂ Mach-Zehnder 电光调制器 TE 和 TM 模的半波电压几 乎相等,即在不同的偏振模式下,电光效应没有显著 差别,因此电光效应的测试实验中不必对入射光的 偏振进行控制.

MZ波导调制器的一个臂上蒸镀的 Ti 和 Ni 作 为极化正电极,硅片背面相应位置涂抹导电胶作为 地电极,并在两电极上分别用导电胶粘上铜导丝作 为电极引线.将样品的正电极和地电极分别与高压 电源的正电极和地电极相连,如图 5 所示.通过单模 光纤把波长为 1550nm 的光波耦合进入 MZ 电光调 制器一端,用光功率计在另一端实时测量输出光强. 缓慢升高调制电压,每升高 50V 记录一次输出光强, 得到极化前的调制电压-输出光强曲线,见图 6.



图 5 电光效应测量装置示意图

然后对样品进行热极化处理.把样品置于高温 炉内,将样品的正电极和地电极分别与高压电源的 正电极和地电极相连.经过1h缓慢升温,从室温升 至300℃,保持恒温.对波导施加电压,从0V开始慢 慢升到3.5kV,保持恒温恒电压1h,然后缓慢降温, 为了防止高温下内电场退化,必须在温度降至室温 后才撤去外电场.整个过程大约持续3—4h.

热极化处理后,再次测量样品的调制电压-输出 光强曲线见图 6),与热极化前的结果进行比较和 分析.

5. 结果分析与讨论

如图 6 所示,热极化前样品的半波电压约为 3500V,热极化后半波电压约为 1500V,分别计算出 极化前后样品的二次电光系数 $s = \frac{\lambda d^2}{n^3 V_{\pi}^2 L}$,其中, λ 为测试光波长,d 为波导厚度(即上下电极距离),n



图 6 SiO₂ 脊形波导 MZ 调制器的输出光强与外加电压曲线

为波导层折射率, V_{π} 为半波电压,L为电场作用长度(即电极长度).极化前后样品的二次电光系数分别为 1.56×10⁻²²(m/V)²和 8.50×10⁻²²(m/V)²,即 热极化使样品的二次电光系数提高到极化前的近 5.5倍.根据 $r = \frac{\lambda d}{n^{3} V_{\pi} L}$,得到极化后样品的线性电 光系数为 0.093pm/V,比我们在较早时期对不同覆 盖层厚度的同类结构极化得到的线性电光系数 (0.05pm/V)¹⁵¹高出近一倍,且显著优于日本 NTT 公 司报道的基于掩埋式波导的 0.02pm/V 的线性电光 系数^[13].实验结果与我们前面的理论分析是一致的, 即热极化过程形成并增强了材料内部的冻结电场,从 而引起明显的线性电光效应及二阶非线性效应.

图 6 中可以看到,器件在极化后的输出功率比 极化前小,即器件极化后插入损耗变大.这是由于器 件在极化前的电光效应测试之后经历了一系列的实 验步骤,如:在样本上去除及制作电极、热极化、清洗 样品等等,特别是去除金属电极的步骤较复杂(包括 金属电极及导电胶的溶解,酸碱液清洗,超声清洗等 步骤),这些实验过程不可避免地损伤波导的端面和 表面,因此增大了波导的损耗.因此器件的制作及测 试整个过程还需进一步改善,以减小器件的插入 损耗.

6.结 论

本文对具有上覆盖层的 SiO₂ 脊形条波导结构 进行了优化 利用微电子工艺制作了 SiO₂ 脊形条波 导和 MZ 型电光调制器 ,在此基础上研究热极化引 起的电光效应及非线性效应 ,得到了 0.093pm/V 的 线性电光系数 ,约为未经优化的同类波导结构极化 后线性电光系数(0.05pm/V)¹⁵¹的两倍 ,显著优于已 有报道的基于掩埋式波导极化后的线性电光系数 (0.02pm/V)¹³¹ ,并对热极化引起的电光和非线性效 应进行了理论分析.

- [1] Myers R A , Mukherjee N ,Brueck S R J 1991 Opt . Lett . 16 1732
- [2] Fujiwara T , Wang D , Zhao Y , Fleming S , Poole S Sceats M 1995 Electron. Lett. 31 573
- [3] Corbari C , Mills J D , Deparis O , Klappauf B G , Kazansky P G 2002 Appl. Phys. Lett. 81 1585
- [4] Blazkiewicz P , Xu W ,Fleming S 2002 J. of Lightwave Technology 20 965
- [5] Okada A, Ishii K, Mito K, Sasaki K 1992 Appl. Phys. Lett. 60 2854
- [6] Kazansky P G , Kamal A K ,Russell P St J 1993 Opt . Lett . 18 693
- [7] Fokine M , Saito K , Ikushima A J 2005 Appl. Phys. Lett. 87
- [8] Qiu M X, Mizunami T, Koya H, Pi F, Orriols G 1998 Proceedings of Nonlinear Optics 98 370
- [9] Luo Y, Biswas A, Frauenglass A, Brueck S R J 2004 Appl. Phys.

Lett. 84 4935

- [10] Deparis O, Mezzapesa F P, Corbari C, Kazansky P G Sakaguchi K 2005 J. of Non-Crystalline Solids 351 2166
- [11] Takebe H, Kazansky P G, Russell P St J, Morinaga K 1996 Opt. Lett. 21 468
- [12] Bai Y X, Zhang Z H, Fan D Y, Wang Z J, Zhang G Q 1994 Acta Phys. Sin. 43 1564 (in Chinese)[白迎新、张筑虹、范滇元、王 之江、张国庆 1994 物理学报 43 1564]
- [13] Abe M, Kitagawa T, Hattori K, Himeno A, Ohmori Y 1996 Electron. Lett. 32 893
- [14] Bahaa E A Saleh ,Malvin Carl Teich 1991 Fundamentals of Photonics (New York : John Wiley & Sons , Inc)
- [15] Cao X ,He S 2003 Chin . Phys . Lett . 20 1081



Electro-optic effect induced by thermal poling in SiO₂ ridge waveguides *

Cao Xia Qin Hai-Yan[†] Cheng Li-Hua

(State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)
(Received 29 November 2005; revised manuscript received 15 March 2006)

Abstract

The structure of silica ridge waveguides with upper-cladding is optimized by theoretical simulation. Based on this design , a Mach-Zehnder electro-optic modulator is fabricated by micro-electronics techniques , which is used for the study of electro-optic effect and nonlinear effect induced by thermal poling. The nonlinear effects in silica are improved after thermal poling , with 0.093 pm/V and $8.50 \times 10^{-22} (\text{ m/V})^2$ achieved in the experiment for linear effects in silica by thermal poling is also analyzed theoretically.

Keywords: electro-optic modulator, SiO₂ waveguide, electro-optic effect, thermal poling **PACC**: 4280K, 4280L, 7820J, 4265

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60377022, 60408001) and the Scientific Research Starting Foundation for Returned Overseas Chinese Scholars, Ministry of Education, China.

[†] Corresponding author. E-mail: hattieqin@coer.zju.edu.cn